PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-182228

(43)Date of publication of application: 05.07.1994

(51)Int.CI.

B01J 35/10

(21)Application number: 04-336215

(71)Applicant: IBIDEN CO LTD

(22)Date of filing:

16.12.1992

(72)Inventor: TAKADA KOZO

(54) PRODUCTION OF CATALYST CARRIER

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a catalyst carrier made of a porous silicon carbide sintered body having a high strength, a large specific surface area and a large pore volume.

CONSTITUTION: Silicon carbide powder having 0.1-5m2/g specific surface area and contg. 1.0-5% impurity components preferably including 0.1-0.5% (expressed in terms of boron) boron compd. is used as starting material, compacted into a desired shape, dried and fired in the temp. range of 1,600-2,200° C to produce the objective catalyst carrier.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of

12.11.2002

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3548914

[Date of registration]

30.04.2004

[Number of appeal against examiner's decision

2002-23893

of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

12.12.2002

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-182228

(43)公開日 平成6年(1994)7月5日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 0 1 J 35/10

3 0 1 J 7821-4G

F 7821-4G

H 7821-4G

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号

特顯平4-336215

(71)出願人 000000158

イピデン株式会社

(22)出願日

平成 4年(1992)12月16日

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

(72)発明者 高田 孝三

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1の1 イビデ

ン株式会社北工場内

(74)代理人 弁理士 田中 宏 (外1名)

(54) 【発明の名称 】 触媒担体の製造方法

(57)【要約】

【目的】本発明は高い強度、大きな比表面積と細孔容積を有する多孔質炭化ケイ素焼結体からなる触媒担体の製造方法を提供することを目的とする。

【構成】本発明は、比表面積が0.1~5㎡/gr、不純物成分が1.0~5%の炭化ケイ素粉末、さらに好ましくは不純物成分中にホウ素化合物が金属換算で0.1~0.5%含有している炭化ケイ素粉末を出発原料とし、これを所望の形状に成形、乾燥後、1600℃~2200℃の温度範囲で焼成することを特徴とする触媒担体の製造方法である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 比表面積が0.1~5 m²/g r、不純物成分が1.0~5%の炭化ケイ素粉末を出発原料とし、これを所望の形状に成形、乾燥後、1600℃~2200℃の温度範囲で焼成することを特徴とする触媒担体の製造方法。

【請求項2】 不純物成分中にホウ素化合物が金属換算で0.1~0.5%含有していることを特徴とする請求 項第1項記載の触媒担体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は高い強度、大きな比表面 積と細孔容積を有する多孔質炭化ケイ素焼結体からなる 触媒担体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】炭化ケイ素は高い硬度、優れた耐摩耗性、優れた耐酸化性、優れた耐蝕性、良好な熱伝導率、低い熱膨張率、高い耐熱衝撃性、並びに、高温での高い強度等の化学的および物理的に優れた特性を有し、メカニカルシールや軸受け等の耐摩耗材料、高温炉用の耐火 20材や熱交換器または燃焼管等の耐熱構造材料、酸およびアルカリ等の強い腐蝕性を有する溶液のポンプ部品等の耐蝕性材料として広く使用可能な材料である。

【0003】一方、これらの性質を有する炭化ケイ素と、その結晶が形成する通気性を有するところの気孔、すなわち開放気孔とからなる多孔質炭化ケイ素質焼結体は、前記炭化ケイ素の特徴を生かして、高温雰囲気、酸化性雰囲気及び/または腐蝕性雰囲気下における耐熱、耐蝕性物質分離材料として利用可能であり、例えば内燃機関の排気ガス、特にディーゼルエンジンの排気ガス等の高温気体中に含まれる微粒子カーボン等の微粒子物質の除去のために使用されるフィルターとして利用しうる。更に、この多孔質炭化ケイ素フィルター表面に、酸化反応用触媒成分を担持せしめた場合には、可燃性のカーボン微粒子を燃焼せしめ、ガスに転化させることも可能で、この場合、この多孔質炭化ケイ素フィルターは、耐熱・耐蝕触媒としても機能することになる。

【0004】また最近、主として環境汚染防止の観点から、内燃機関やガスタービン用ボイラーなどの工業用燃焼装置の分野において、低NOx燃焼技術の研究開発が行われており、その一つとして燃焼触媒を用いる触媒燃焼技術が注目を集めている。この触媒燃焼技術の開発における最も重要な要素は、触媒の開発であり、触媒の開発においては活性な酸化反応用触媒物質の開発と並んで、活性成分を分散、担持するための担体の開発が極めて重要である。

【0005】燃焼触媒用担体においては、触媒表面で進行する燃焼反応、すなわち、酸化反応を迅速に生起せしめるために表面積が大きいことに加えて、発生する反応熱を有効に伝達・除去できるような良好な熱伝導度を有50

すること、および、触媒細孔内の物質移動を有効に行わせるためにガス等の流体の通過抵抗が小さいこと、すなわち、細孔容積が大きいこと、更に、成形体相互のぶつかり合いによるアブレイジョン、即ち、磨滅に強いことおよび成形体自身が十分な機械的強度を有すること、そして、これらの特性が長時間の使用に対して安定していることなど、多くの要求を満足することが必要である。このような要件は、燃焼触媒のみならず、一般に反応熱の発生を伴なう化学反応用の触媒担体、あるいは高温で使用される触媒用の担体についても共通的にいえることである。

【0006】一方、多孔質炭化ケイ素質焼結体の製造方 法としては、(1)骨材となる炭化ケイ素粒子にガラス 質フラックス、あるいは粘土質などの結合材を加え成形 した後、その成形体を前記結合材が溶融する温度で焼き 固めて製造する方法、(2)粗大粒の炭化ケイ素粒子と 微細な炭化ケイ素粒子を混合し成形した後、2000℃ 以上の髙温で焼成して製造する方法、あるいは(3)特 開昭48-39515号の発明で開示されている炭化ケ イ素粉に炭素粉を加え、または加えずに炭素質バインダ - を加えると共に、炭素粉および焼成時に生成されるバ インダーからの遊離炭素と反応する理論量のケイ素質粉 を添加して形成し、しかる後、この成形体中の炭素粉中 で1900~2400℃に加熱して成形体中の炭素分を ケイ素化することを特徴とする均質多孔性再結晶炭化ケ イ素体の製造方法、(4)比表面積が3m³/g以上 で、ホウ素、アルミニウムおよび鉄の含有量の合計が元 素に換算して0.3重量%以下である炭化ケイ素粉末を 所望の形状に成形後、1600~2200℃で焼成して 製造する方法等が従来知られている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し た従来技術には次の問題がある。

(1) 骨材となる炭化ケイ素粒子にガラス質フラックスあるいは粘土質などの結合材を加え成形した後、その成形体を前記結合材が溶融する温度で焼き固めて製造する方法は、結合材が低温(1000~1400℃前後)で溶融するため、多孔質体はこの温度域、特にガラス転移温度付近で変化し着しく強度が低下するだけでなく、耐薬品性、耐酸化性が要求される分野における使用が限られるという欠点がある。

【0008】(2)粗大粒の炭化ケイ素粒子と微細な炭化ケイ素粒子を混合し成形した後2000℃以上の高温で焼成して製造する方法、あるいは、(3)特開昭48-39515号の発明で開示されている炭化ケイ素粉に炭素粉を加え、または加えずに炭素質バインダーを加えると共に、この炭素粉及び焼成時に生成されるバインダーからの遊離炭素と反応する理論量のケイ素質粉を添加して形成し、しかる後、この成形体中の炭素粉中で1900~2400℃に加熱して成形体中の炭素分をケイ素

20

化することを特徴とする均質多孔性再結晶炭化ケイ素体 の製造方法は、多孔質炭化ケイ素骨材とその骨材を被覆 して、骨材同志を結合する炭化ケイ素質結合材あるいは 炭素質結合材および間隙とが構成される。前記多孔質の 間隙、すなわち開放気孔は殆ど成形時に骨材粒子となる 粗大粒子を多く必要としその結果骨材粒子の接触点が少 なくなり、多孔質の強度は著しく低下し、しかも比表面 積は0.5㎡/g以下で著しく小さいものとなる。

【0009】一方、強度の高い多孔質体とするためには 骨材の粒度配合を粗粒と中程度/または微粒子と適度に 10 混合し形成することが必要でありその結果、多孔質体の 細孔容積は高々O.1ml/gで著しく小さく極端な場 合、一部の開放気孔が閉塞してしまう傾向がある。との ため、このような、多孔質体を流体が通過する際の抵抗 は著しく高くなり、物質分離用フィルターや、触媒担体 素として利用する場合、著しく不利益となる。従って、 触媒担体として好適な特性を有する炭化ケイ素質焼結体 即ち、取扱いが容易な強度を有し、しかも細孔容積が 0. 2 m¹/gより大きく、比表面積が3 m¹/gより大 きな多孔質炭化ケイ素質焼結体は存在しない。

【0010】(4)前記のような性質を有する多孔質体 を製造する方法として出願人は先に提案した方法がある が、この方法は、比表面積が3 m²/g以上で、ホウ 素、アルミニウム、および鉄の含有量が合計で0.3重 量%以下のものを用い、1400~2000℃で焼成す る方法は髙純度で、且つ超微粉炭化ケイ素を出発原料と しているために著しくコストアップとなるだけでなく、 成形体の乾燥収縮率が大きくなって、乾燥亀裂が発生し 易い欠点をすること:ディーゼル・エンジン排ガス中の パーティキュレート・フィルターのように気孔径が15 μπ前後が適切であるのに対して、数μπ前後又はそれ 以下の気孔径のものしか得られない。気孔径を大きくす る方法としては焼成温度を2000℃以上で行えば良い が、前記方法では異常粒成長等により強度劣化を起すこ ととなる等の欠点を有していた。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記従来の欠 点を解消し、かつ改善して、耐熱触媒担体として必要な 特性を有する多孔質炭化ケイ素質焼結体からなる触媒相 体を供給するために、比表面積が0.1~5 m²/g r、不純物成分が1.0~5%の炭化ケイ素粉末を出発 原料を所望の形状に成形、乾燥後、1600℃~220 O ℃の温度範囲で焼成することを特徴とするものであ

【0012】即ち、従来、比表面積が5m³/gr以上 と大きく、不純物が少なく、又は/及び、平均粒径が1 μm以下と小さい炭化ケイ素 (β-SiC) 粉末を出発 原料とすることによってのみ触媒担体用として優れた多 孔質炭化ケイ素焼結体が製造出来るものと思われて来 た。即ち、平均粒径が1μm以下の超微粉が焼結(ネッ 50 実施例 1

キング)して成長をすることにより、成形体の中で炭化 ケイ素粉末が占有している体積が減少し、これにより細 孔容積が増大すると同時に触媒担体又は/およびフィル ターとして最適な連続気孔が出来ること、そして、原料 粉末に適した最高焼成温度で焼成することにより、最適 な気孔径の触媒担体が製造出来るものであって、不純物 が少しでも多かったり、比表面積又は/および平均粒径 が少しでも大きいと不適当であるとされて来た。

【0013】しかし、多孔質炭化ケイ素焼結体の製造に ついて、各種生成条件と得られた生成粒との関係を詳細 に研究した結果、比表面積が小さく、不純物が一定範囲 で大きく、且つ、好ましくは不純物として、焼結助剤と して作用するホウ素化合物が金属換算で0.1~0.5 %範囲で混入して炭化ケイ素 (α-SiC) 粉末を用い ることにより触媒担体として優れた性能を有する多孔質 炭化ケイ素質焼結体からなる触媒担体を経済的に製造す ることを見出したのである。すなわち、本発明において は、比表面積が0.1~5m1/gr、不純物成分が 1.0~5%の炭化ケイ素粉末を使用するのであって、 この比表面積の範囲において、比表面積が大きくなるに したがって、その不純物成分が1.0~5%の範囲で少 なく、且つ、最髙焼成温度範囲の1600~2200℃ において、高くすることが重要である。

【0014】比表面積が0.1m²/grより小さくな ると、触媒担体の細孔容積および比表面積が小さくなり 過ぎるので好ましくない。又、比表面積が5 m²/g r 以上の炭化ケイ素粉末を出発原料とすることは出発原料 コストが著しく高くなり、好ましくない。不純物成分が 1%以下の出発原料とすると、前記同様に経済的でな い。また、5%以上とすると触媒担体の高温強度が低下 する等の欠点が生じて好ましくない。このような出発原 料は、古くから製造されているα-SiCの製造方法 (アチソン法) によって容易に得ることができる。

【0015】焼成温度について、最高焼成温度を160 0℃以下にすると前記同様に触媒担体の高温強度が低下 する等の欠点が生じて好ましくなく、2200℃以上で は製造コストが著しく高くなってしまう。

【0016】尚、不純物成分中にはホウ素化合物が金属 換算で0.1~0.5%含有していることが好ましい。 40 すなわち、ホウ素化合物は、前記炭化ケイ素粉出発原料 の焼結助剤としての作用をするものである。0.1%以 下では助剤としての効果が小さ過ぎ、0.5%以上にす ると成形体の収縮率が大きくなってしまうので焼成最高 温度を低下させなければならなくなるが、焼成最高温度 を低下させることは、触媒担体の高温強度の劣化等の欠 点を生ずることとなる。次に、実施例をもって、更に本 発明を具体的に説明する。

[0017]

【実施例】

比表面積0.7 m²/gで不純物含有量3.0%(B,C が0.3%)のα-炭化ケイ素を70%と、比表面積1 2 m²/g で不純物含有量1.0%のβ-炭化ケイ素を 30%とを混合した炭化ケイ素粉末100重量部に、水 22重量部、メチルセルロース 重量部、グリセリン 2部、界面活性剤4部とを混合、混練した坏土を押出成 形機で外径140m/m、長さ70m/m、セル厚0. 43 m/m、セル数170コ/i n¹の成形体を成形・ 乾燥後、1800℃で4時間焼成した結果、気孔率45 %、焼成収縮率2%、平均気孔径 15μ m、曲げ強度4 10 する触媒担体が得られる。

50kg/cm³(セル温度)のハニカム構造の多孔質 炭化ケイ素質触媒担体が得られた。

[0018]

【発明の効果】以上述べたように、本発明においては、 比表面積が0.1~5 m²/g r 、不純物成分が1.0 ~5%の炭化ケイ素粉末を出発原料とし、これを160 0℃~2200℃の温度範囲で焼成することによって、 従来の多孔質炭化ケイ素よりなる触媒担体に比して高い 強度、大きな比表面積と細孔容積を有する等の特性を有